

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0507(4)ว 26

ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้จัดลำดับผู้สมัคร (Priority List) เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และ JPO พิจารณาต่อไป หลักสูตรที่เปิดรับสมัครจำนวน 5 หลักสูตรมีดังนี้

1. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for IP Trainers
 - กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2560
 - กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
2. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers
 - กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
 - กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
3. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Patents
 - กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560
 - กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
4. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks
 - กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560
 - กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 29 กันยายน 2560
5. หลักสูตร JPO/IPR Training Course on Managing IP
 - กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2560
 - กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 29 กันยายน 2560

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฝึกอบรมดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดทุนและการสมัครจากเว็บไซต์

www.ipthailand.go.th หัวข้อกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อโปรดทราบ/เห็นชอบขอรับ

ดร.อ.ทศพร กิ่งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ / เห็นชอบขอรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา
โทร. 0 2610 5407 โทรสาร 0 2354 5570

กิตติพงษ์ เกษม

19/5/60

กิตติพงษ์ เกษม

7 พ.ค. ๕๖

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐

19 พ.ค. 2560